

A eletrodeposição se apresenta como uma técnica alternativa bastante vantajosa para a obtenção de filmes finos magnéticos interessantes para aplicação em elementos de memória de computadores, pois os mesmos podem ser depositados em superfícies de geometria complexa e o custo do processo é diminuto. No presente trabalho se investigou a influência de determinadas condições de deposição sobre a estrutura e propriedades de filmes finos de Ni e Ag. Os filmes foram obtidos a partir de eletrólitos duplos (cianeto de prata / níquel-Watts, nitrato de prata / níquel-Watts, com e sem aditivos) e simples-(solução à base de perclorato de prata e sulfamato de níquel ou perclorato de prata e sulfato de níquel) para diferentes espessuras de camadas intermediárias. Sua caracterização foi realizada através de microscopia eletrônica de varredura, de curvas de histerese magnéticas e da magnetoresistência dos filmes.